

1. Record Nr.	UNINA9910136753003321
Autore	Battiston Simone
Titolo	Lontane da casa : Donne italiane e diaspora globale dall'inizio del Novecento a oggi
Pubbl/distr/stampa	Torino, : Accademia University Press, 2015
ISBN	88-99200-08-4 88-99200-09-2
Descrizione fisica	1 online resource (354 p.)
Altri autori (Persone)	BeneduziLuís Fernando GarroniMaria Susanna GissiAlessandra GreenNancy L GrossuttiJavier P HoussiLeila El LuconiStefano PinnaPietro PronteraGrazia RossettiSara SestigianiSabina TirabassiMaddalena VarricchioMario
Soggetti	Italians - Foreign countries - History - 20th century Women immigrants - History - 20th century Emigration and immigration Italians - Foreign countries Women immigrants Italienerin History Italy Emigration and immigration History 20th century Italy
Lingua di pubblicazione	Italiano
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia

Nel contesto del crescente interesse per le tematiche e la prospettiva di genere nell'esame dei movimenti di popolazione in ambito globale, il volume si propone di fornire un contributo allo sviluppo della storiografia sulle migrazioni femminili italiane attraverso undici casi studio basati su ricerche e fonti originali, preceduti da due ampie rassegne storiografiche. Partendo da conoscenze consolidate, questa raccolta di saggi apre nuove prospettive d'indagine, identificando elementi comuni ed esperienze peculiari delle vicende delle donne di origine o di ascendenza italiana nel mondo. L'approccio si configura come storicamente diacronico, con attenzione all'intero arco del Novecento fino agli anni più recenti. Da un lato, il libro approfondisce le conoscenze sui flussi verso i paesi europei, le Americhe e l'Australia; dall'altro, fornisce elementi sull'esodo diretto in regioni che le analisi precedenti hanno lasciato in ombra, come il Nord Africa francese negli anni tra le due guerre mondiali. Soprattutto, il volume declina in una dimensione specificamente femminile gli orientamenti e gli interessi più recenti della letteratura sulle migrazioni italiane quali il transnazionalismo, l'impegno politico (con particolare rilievo per la militanza antifascista), la nostalgia per la terra natale e il senso dell'appartenenza etnica nelle loro poliedriche e molteplici implicazioni.

2. Record Nr.	UNINA9911004829503321
Titolo	EUV sources for lithography // [edited by] Vivek Bakshi
Pubbl/distr/stampa	Bellingham, Wash., : SPIE Press, c2006
ISBN	1-61583-716-7 0-8194-8071-1
Descrizione fisica	1 online resource (1094 p.)
Collana	SPIE Press monograph ; ; PM149
Altri autori (Persone)	BakshiVivek
Disciplina	621.36/4
Soggetti	Ultraviolet radiation - Industrial applications Extreme ultraviolet lithography Plasma (Ionized gases) Lithography
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Description based upon print version of record.
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references and index.
Nota di contenuto	section 1. Introduction and technology review -- section 2. Fundamentals and modeling -- section 3. Plasma pinch sources -- section 4. Laser-produced plasma (LPP) sources -- section 5. EUV source metrology -- section 6. Other types of EUV sources -- section 7. EUV source components.
Sommario/riassunto	This comprehensive volume, edited by a senior technical staff member at SEMATECH, is the authoritative reference book on EUV source technology. The volume contains 38 chapters contributed by leading researchers and suppliers in the EUV source field. Topics range from a state-of-the-art overview and in-depth explanation of EUV source requirements, to fundamental atomic data and theoretical models of EUV sources based on discharge-produced plasmas (DPPs) and laser-produced plasmas (LPPs), to a description of prominent DPP and LPP designs and other technologies for producing EUV radiation. Additional topics include EUV source metrology and components (collectors, electrodes), debris mitigation, and mechanisms of component erosion in EUV sources. The volume is intended to meet the needs of both practitioners of the technology and readers seeking an introduction to the subject.

